

公開番号 又は 特許番号	特開 2012-187674
発明名称	マイクロ構造の製造方法、マイクロ構造体、受光素子及び粒子検出器
出願人 又は 権利者	セイコーインスツル株式会社、独立行政法人 産業技術総合研究所
想定デバイス	環境物質高感度センサ、アンビエントデバイス、その他
要約	<p>【利用分野】 マイクロ構造の製造方法、マイクロ構造体、受光素子及び粒子検出器に関するもの。</p> <p>【発明の内容】 入射角が大きな光に対する感度を向上させるもので、そのために、マイクロ構造の製造方法は、シリコン基板 50 の被エッチング部に等方性プラズマエッチングを行なうステップと被エッチング部の少なくとも側面に保護膜を形成するステップとを交互に実行する第 1 エッチング工程と、第 1 エッチング工程の実行後に、被エッチング部に等方性プラズマエッチングを行なう第 2 エッチング工程とを含み、シリコン基板 50 の内部に向かい弧状に膨出する複数の凹部 50c から成るマイクロ構造を形成する。</p>
図面	